

平均转移率列入表 1，并在图 1 中示出。用金硅面垒型半导体探测器测量的 Schmitt 谱参数与推荐值<sup>[4]</sup>十分接近，说明自转移源的品质是良好的。

表 1 初始源强度和自转移率

初始源编号	1	2	3	4	5
<sup>252</sup> Cf 含量, $\mu\text{g}$	0.0025	0.0865	0.277	0.293	0.757
厚度, $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	0.005	0.172	0.551	0.583	1.51
自转移率/小时, $\times 10^{-4}$	0.124	0.810	2.670	0.890	21.7

### 参 考 文 献

- [1] Raymond C. Gatti et al., UCRL-9566 (1960), p. 184.
- [2] S. Pauker & N. H. Steiger-Shafir, *Nucl. Instrum. Methods*, 91, 557 (1971).
- [3] 庄人杰等, <sup>252</sup>Cf 自发裂变中子源的回收化学流程, 内部资料, 1980.
- [4] H. W. Schmitt & F. Pleasonton, *Nucl. Instrum. Methods*, 40, 204 (1966).

(编辑部收到日期: 1980年10月28日)

## 测量 D(d, n) 中子通量两种方法的校对

李际周 范培国 卢涵林 黄建周

D(d, n)<sup>3</sup>He 反应是加速器上常用的中子源。在静电加速器上提供  $E_n = 1.7 \sim 5.6 \text{ MeV}$  的中子, 其中子通量用半导体望远镜测量; 在高压倍加器上提供  $E_n = 2 \sim 3 \text{ MeV}$  的中子, 其中子通量可以用竞争反应的伴随粒子法测量。为了校核两种方法测量中子通量的可靠性, 我们在高压倍加器上,  $E_d = 250 \text{ keV}$  时, 同时采用两种方法进行测量。经过反复校对数次, 表明两种方法测得的结果在误差范围内一致, 从而为进一步测量这段能区的 (n,  $\nu$ ), (n, n') 和 (n, x) 截面以及刻度剂量仪表等工作提供了可靠的中子通量测量方法。

### 一、实验安排

在高压倍加器上利用 D(d, n)<sup>3</sup>He 反应作中子源, 氚靶厚度  $\geq 0.7 \text{ mg}/\text{cm}^2$ ,  $E_d = 250 \text{ keV}$ 。在氘束入口处, 装有  $\phi 8 \text{ mm}$  的钽光阑, 以保证入射氘束能尽量打在氘靶上。在钽光阑与望远镜之间挡有聚乙烯影柱, 以防止钽光阑上的 D(d, n) 中子进入望远镜 (参见图 1)。

所采用的伴随粒子直角靶管是过去校对 T(d, n) 中子通量<sup>[1]</sup>曾经用过的, 几何尺寸可靠。用来探测伴随粒子的金硅面垒型半导体的电阻率是  $2 \text{ k}\Omega \cdot \text{cm}$ , 偏压为 35 V。所测得的伴随粒子谱见图 2。图中的两个峰, 右边是质子, 左边是氚。它们是由 D(d, n)<sup>3</sup>He 的竞争反应 D(d, p)T 反应所产生的。D(d, n)<sup>3</sup>He 中的 <sup>3</sup>He 粒子能量小, 湮灭在散射氘叠加后所形成的噪声中了。只有当  $E_d \leq 150 \text{ keV}$  时, <sup>3</sup>He 峰才清晰可见。由图 2 可知本工作伴随粒子探测的是竞争反应 D(d, p) 中的质子峰, 并不是直接探测 D(d, n)<sup>3</sup>He 反应中的 <sup>3</sup>He 粒子。由探测到的质子数目  $N_p$ , 推算出中子通量的方法和公式见文献[2]。

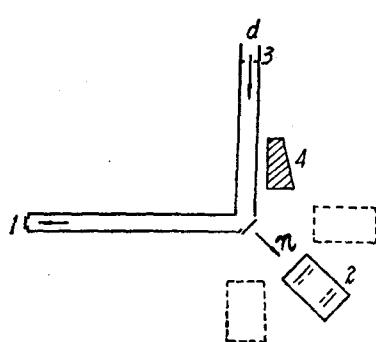


图 1 校对实验安排示意图  
1—金硅面垒型半导体; 2—真空望远镜;  
3—光阑; 4—聚乙烯柱。

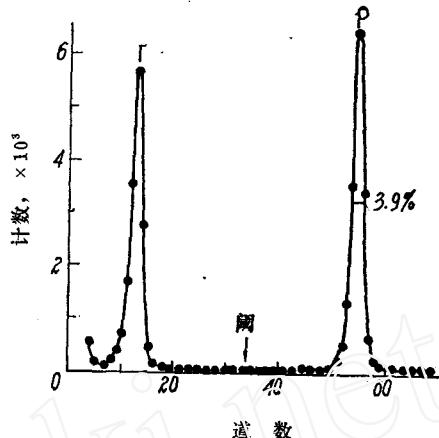


图 2 伴随粒子谱

在与入射氘束成  $\varphi$  角处  $\Delta\Omega_p$  立体角内记录到  $N_p$  个质子, 相当于与入射氘束成  $\theta$  角处单位立体角内的中子通量为:

$$\phi_n(\theta, E_d) = \frac{N_p}{\Delta\Omega_p} A_p.$$

其中  $\Delta\Omega_p$  是探测伴随粒子的半导体前面的光阑对靶所张的立体角;  $A_p$  称为各向异性因子。

$$A_p = \frac{\left[ \frac{dW}{dW'} \right]_p (\varphi)}{h_p(\varphi')} \cdot \frac{\sigma_n(E_d)}{\sigma_p(E_d)} \cdot \frac{h_n(\theta')}{\left[ \frac{dW}{dW'} \right]_n (\theta)}.$$

这里  $h_p(\varphi')$  和  $h_n(\theta')$  分别为  $D(d, p)$  和  $D(d, n)$  反应质心系的角分布修正因子;  $\left[ \frac{dW}{dW'} \right]_p (\varphi)$  和  $\left[ \frac{dW}{dW'} \right]_n (\theta)$  分别为两反应的实验室系对质心系的转换因子;  $\frac{\sigma_n(E_d)}{\sigma_p(E_d)}$  为两反应截面比。

由于氘束在氘靶 ( $\geq 0.7 \text{ mg/cm}^2$ ) 中不断损失能量, 必须求平均氘能  $\bar{E}_d$ 。由于  $D(d, n)$  反应的微分截面随中子出射角度  $\theta$  不同而异, 所求得的  $\bar{E}_d$  随着  $\theta$  的不同也有微小的变化。当  $E_d = 250 \text{ keV}$  时,  $\theta = 0^\circ$ ,  $\bar{E}_d = 177 \text{ keV}$ ;  $\theta = 45^\circ$ ,  $\bar{E}_d = 172 \text{ keV}$ ;  $\theta = 90^\circ$ ,  $\bar{E}_d = 170 \text{ keV}$ 。对于不同的  $\bar{E}_d$ , 可以直接在文献[2]上查表求出  $A_p$  值。

另一路采用真空半导体望远镜, 这个望远镜曾经在  $E_n = 1$  和  $1.5 \text{ MeV}$  与含氢正比管同时测中子通量, 两种方法的校对在误差范围内一致, 说明至少这个望远镜的几何尺寸是可靠的。望远镜的效率可以查表<sup>[1]</sup>, 所用的几何参数  $\rho = \frac{1}{4}$ ,  $L = 4$ ,  $\rho$  和  $L$  的定义见文献[1]。聚乙烯辐射体厚度为  $3.10 \text{ mg/cm}^2$ 。探测到的反冲质子谱见图 3。校对测量时, 望远镜主要放在  $\theta = 45^\circ$  处,  $0^\circ$  和  $90^\circ$  也分别做过两次校对。

## 二、误差分析

伴随粒子一路误差情况见表 1, 主要来源是由于  $D(d, n)$  和  $D(d, p)$  反应角分布。因为伴随的是竞争反应的粒子, 增加了竞争反应角分布和两反应截面比这两个因素, 这是  $D(d,$

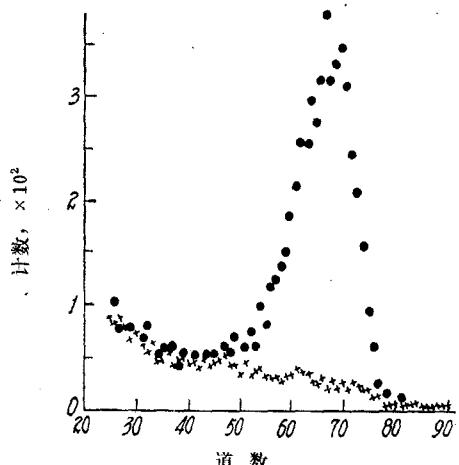


图 3 反冲质子谱及其本底

n) 反应伴随粒子法测中子通量误差较大的主要原因。简单的<sup>3</sup>He粒子伴随只有在入射  $E_d \leq 150\text{keV}$  时才有可能实现。我们在文献[2]中计算出的  $A_p$  值表所采用的  $D(d, n)$ ,  $D(d, p)$  以及两反应截面比等数据引自文献[3], 相应的误差考虑也同样引自文献[3]。

望远镜一路误差情况见表 2。由于中子能量较低,  $n-p$  散射各向异性不严重, 对中子通量误差的影响较小。表 2 中所列望远镜几何误差是对于  $\theta = 45^\circ$  的情况, 此时辐射体所在平面与靶面平行, 距离误差较小。对于  $\theta = 0^\circ$  和  $90^\circ$  情况, 辐射体所在平面与靶面成  $45^\circ$ , 靶点漂移影响较大, 误差增至  $\pm 2.3\%$ 。靶与望远镜辐射体之间的物质包括钼底衬、冷却水层、望远镜外壳、空气和辐射体背面的铝衬等, 修正量达 2%, 影响中子通量误差为  $\pm 0.5\%$ 。关于计数统计, 作校对实验时, 单次计数积累超过一万。

表 1 伴随粒子方法测中子通量误差

误 差 来 源	误 差, $\pm \%$
$D(d, n)$ 角分布	3
$D(d, p)$ 角分布	3
$D(d, n)$ 和 $D(d, p)$ 两反应截面比	0.5
靶点漂移及靶到光阑距离测量	0.6
光阑面积测量	0.5
本底扣除	0.3
计数统计	0.3
总 计	4.5

表 2 望远镜方法测中子通量误差

误 差 来 源	误 差, $\pm \%$
$n-p$ 全截面	0.5
$n-p$ 散射角分布	0.7
辐射体中单位面积含氢原子数 (包括称重、面积和 $\text{CH}_2$ 比例)	0.7
望远镜和中子源的几何 (包括两光阑直径, 相隔距离和第一光阑距靶距离)	1.3
靶与望远镜辐射体之间物质对中子的吸收和散射修正	0.5
本底扣除	0.7
计数统计	1
总 计	2.2

### 三、结果讨论

在几个月内共作过 4 轮校对实验, 每轮结果两种方法比较都在误差范围内一致。最后一

表 3 测中子通量最后一次校对实验结果

入射氘束能量 $E_d$ , MeV	望远镜/伴随粒子	校 对 次 数	平均值标准偏差, ±%
250	1.028	13	1.3
300	1.015	10	0.8
200	1.018	3	1.8

次校对实验的结果列于表 3 中。

上述结果表明两种方法比较虽然在误差范围内是一致的，但望远镜测得的中子通量平均结果稍高于伴随粒子的结果，这可能是因为伴随粒子方法探测的是竞争反应的粒子，要采用两个反应的角分布和截面比，误差比较大，因而存在一定的系统误差；也可能是由于氘束打在靶片外的管道上或光阑上，与原吸附在其上的氘粒子产生  $D(d, n)$  中子被望远镜记录，而不被伴随粒子所记录的缘故。因此在使用加速器时必须严格控制条件，使氘束尽可能打在靶片上。

### 参 考 文 献

- [1] 李际润等, 原子能科学技术, 1, 100(1977)。
- [2] 中国科学院原子能研究所快中子激发曲线组编, 加速器单能中子源常用数据手册, 218页, 内部资料, 1976年。
- [3] R. B. Theus et al., Nuclear Physics, 80, 273 (1966).

(编辑部收到日期: 1980年3月12日)

## 氯化银固体径迹探测器的试制

赵裕民 刘涿蓬

自从发现掺杂氯化银单晶片可以记录带电粒子后, 二十年来国外一些实验室对它进行了一系列的研究<sup>[1,2,3]</sup>。它的基本特性是:

1. 可记录带电粒子 其灵敏度与所掺杂质的种类和数量有关。目前, 以掺 5000 ppm 镉离子灵敏度最高, 对质子灵敏阈约为 30 MeV。

2. 潜影衰退及稳定 受带电粒子照射后在粒子的路径上形成潜影, 如不及时稳住, 潜影会自行消失, 此衰退的时间与粒子的种类及单晶片的制造工艺有关, 约几分钟到几个小时不等。

如在粒子照射的同时或粒子照射后立即用黄光照射晶片, 就能把潜影稳住, 甚至半年以上时间也不致衰退(用 0.1 W 小灯泡就足够了)。

这就是氯化银探测器的“开关特性”, 是现有固体径迹探测器中唯一能开关的。

3. 显影 用紫外光照射就能使潜影显现出来。所需总光量约  $10^{18}$  光子/ $\text{cm}^2$ , 相当于正常日光下照射数秒钟。用 4100 Å 的近紫外光是很合适的。

4. 受  $\gamma$  射线的影响小  $\gamma$  射线能使潜影衰退, 衰退程度与  $\gamma$  射线能量及粒子种类有关。对于  $\alpha$  粒子径迹,  $\gamma$  射线剂量超过 200 R 以上才会使潜影密度下降。此值远远超过核